



半光鎳 Ni-1

§產品說明

Ni-1 半光鎳專用於印刷電路板打線或一般全面鎳等半光澤鍍鎳工程, 可得極低內應力, 且操作電流密度範圍寬闊, 並可適用於硫酸鎳浴。

§槽液配置

	最適值	範圍
鎳離子	75 克/升	60-90
UCC 胺基磺酸鎳	410 毫升/升	
硫酸鎳	330g/kg	
氯化鎳	30 克/升	10-50
硼酸	40 克/升	30-50
Ni-1	20 毫升/升	

§操作條件

	最適值	範圍
溫度	50°C	(40-50)
PH 值	4.0	(3.8-4.5)
電流密度	2 安培/平方公寸	(0.5-6)
陰陽極面積比	1:2	
攪拌	擺動, 過濾循環, 及無油無塵的空氣攪拌。	
加熱器	石英, 不鏽鋼或鐵氟龍	



§ 維護與控制

1、操作方法

每操作 1000 安培小時，補充 Ni-1 220 毫升。

2、分析方法

①光澤劑以哈氏槽實驗或 CVS 分析後添加校正。

②其他含量，依分析添加。

3、推薦採用胺基磺酸鎳，比重 1.54，鎳含量 180 克/升。

4、有針孔發生時，可添加潤濕劑 Ni-1W 1-2 毫升/升。